

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年12月20日(2007.12.20)

【公開番号】特開2002-241601(P2002-241601A)

【公開日】平成14年8月28日(2002.8.28)

【出願番号】特願2001-44023(P2001-44023)

【国際特許分類】

| | | |
|--------|-------|-----------|
| C 08 L | 71/12 | (2006.01) |
| C 08 J | 5/18 | (2006.01) |
| C 08 K | 5/521 | (2006.01) |
| C 08 L | 67/00 | (2006.01) |

【F I】

| | |
|--------|-------|
| C 08 L | 71/12 |
| C 08 J | 5/18 |
| C 08 K | 5/521 |
| C 08 L | 71/12 |
| C 08 L | 67:00 |

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月2日(2007.11.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) ポリフェニレンエーテル系樹脂51～99.9重量部および(B)液晶ポリエスチル0.1～49重量部からなる樹脂成分100重量部に対して、(C)難燃剤0.1～3重量部を配合してなる樹脂組成物より得られるポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート。

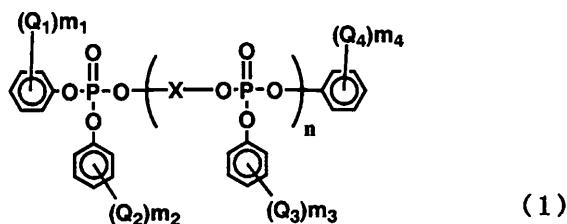
【請求項2】

難燃剤がリン系化合物である請求項1記載のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート。

【請求項3】

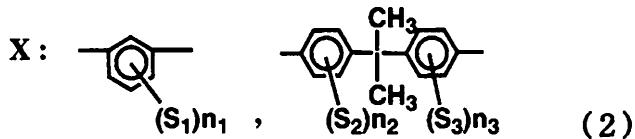
難燃剤が式(1)の構造である請求項1記載のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート。

【化1】



(式中Q₁、Q₂、Q₃、Q₄は、炭素数1から6のアルキル基または水素を表し、nは1以上の整数、m₁、m₂、m₃、m₄は0から3の整数を示し、Xは以下の式(2)のいずれかから選択される。)

【化2】



(式中 S_1 、 S_2 、 S_3 はメチル基または水素を表す。 n_1 、 n_2 、 n_3 は0から2の整数を示す。)

【請求項4】

MDのエルメンドルフ引き裂き強度が3.0(N)以上である請求項1~3のいずれかに記載のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート。

【請求項5】

異方性比ARが、0.75以上である請求項1~4のいずれかに記載のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート。

【請求項6】

難燃剤の量が、(A)と(B)の合計量100重量部に対し、0.1~1.0重量部である請求項1~5のいずれかに記載のポリフェニレンエーテル系樹脂製シート。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

4. MD方向のエルメンドルフ引き裂き強度が3.0(N)以上である1~3のいずれかに記載のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート、

5. 異方性比ARが、0.75以上である1~4のいずれかに記載のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物製シート、

6. 難燃剤の量が、(A)と(B)の合計量100重量部に対し、0.1~1.0重量部である1~5のいずれかに記載のポリフェニレンエーテル系樹脂製シート、

を提供するものである。